

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成24年4月26日(2012.4.26)

【公表番号】特表2011-513565(P2011-513565A)

【公表日】平成23年4月28日(2011.4.28)

【年通号数】公開・登録公報2011-017

【出願番号】特願2010-550151(P2010-550151)

【国際特許分類】

C 10 G 25/00 (2006.01)

C 10 G 29/04 (2006.01)

C 10 G 25/06 (2006.01)

【F I】

C 10 G 25/00

C 10 G 29/04

C 10 G 25/06

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月8日(2012.3.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水銀を含む炭化水素流を担体材料に担持された銅を含む吸収剤に接触させることにより、前記炭化水素流から水銀を除去する方法において、

前記炭化水素流を、水素の存在下で前記吸収剤に接触させ、

前記吸収剤は、10～60質量%の酸化銅、0～40質量%の酸化亜鉛、0～20質量%の酸化アルミニウム、5～25質量%の酸化マグネシウム、10～40質量%の二酸化ケイ素、0～5質量%の酸化クロム(III)及び0～10質量%の酸化バリウムを含むことを特徴とする水銀除去方法。

【請求項2】

前記銅は、多孔質の酸化物の担体材料上に存在することを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記吸収剤は10～60質量%の銅を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】

前記炭化水素流が液体状態で存在していることを特徴とする請求項1～3の何れか1項に記載の方法。

【請求項5】

前記吸収剤が固定床として存在していることを特徴とする請求項1～4の何れか1項に記載の方法。

【請求項6】

前記炭化水素流を上昇流式又は下降流式で前記吸収剤に接触させることを特徴とする請求項5に記載の方法。

【請求項7】

前記吸収剤が炭化水素流中に懸濁状態で存在していることを特徴とする請求項4に記載

の方法。